

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 3 月 1 日 (2007.3.1)

【公開番号】特開 2001-196289 (P2001-196289A)

【公開日】平成 13 年 7 月 19 日 (2001.7.19)

【出願番号】特願 2000-3119 (P2000-3119)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/11 (2006.01)

G 0 3 F 7/30 (2006.01)

G 0 3 F 7/40 (2006.01)

G 0 3 F 7/42 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/312 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 1 L 21/3213 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 6 3

G 0 3 F 7/11 5 0 3

G 0 3 F 7/30

G 0 3 F 7/40 5 2 1

G 0 3 F 7/42

H 0 1 L 21/28 E

H 0 1 L 21/312 D

H 0 1 L 21/312 M

H 0 1 L 21/302 1 0 1 D

H 0 1 L 21/302 1 0 4 H

H 0 1 L 21/88 C

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 1 月 10 日 (2007.1.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

他の方法として現像液の侵入だけを考えた場合、図 9 に示すように、例えば特開平 6 - 1 1 0 1 9 9 号公報に示された、基板 4 0 2 上に形成された A l および C u の合金膜 4 0 1 上に後述する現像液に対する溶解レートの低い有機系反射防止膜 4 0 3 を回転塗布法にて形成し、その有機系反射防止膜 4 0 3 上にレジスト 4 0 5 を形成する方法がある。しかし有機系反射防止膜 4 0 3 は、露光時の下地 4 0 1 からの反射を低減させるためには所定の膜厚が必要であり、例えば露光光として遠紫外線を使用するような場合は 1 0 0 n m 程度と厚い膜厚が必要となる。